

主要半導体材料ガス等国内販売実績5年推移

(暦年:2017年～2021年)



一般社団法人 日本産業・医療ガス協会

単位:kg

		2017年		2018年		2019年		2020年		2021年	
		数量	前年比	数量	前年比	数量	前年比	数量	前年比	数量	前年比
1	アルシン AsH ₃	10,200	91%	9,600	94%	8,600	90%	8,800	102%	8,700	99%
2	ジボラン B ₂ H ₆	360	80%	490	136%	620	127%	750	121%	920	123%
3	三塩化ホウ素 BCl ₃	171,000	117%	160,000	94%	169,000	106%	171,100	101%	—	—
4	四フッ化炭素 CF ₄	658,600	104%	656,500	100%	581,200	89%	589,600	101%	654,000	111%
5	三フッ化メタン CHF ₃	94,100	101%	96,900	103%	79,300	82%	91,200	115%	100,800	111%
6	六フッ化エタン C ₂ F ₆	205,900	115%	179,100	87%	142,300	79%	135,900	96%	139,800	103%
7	八フッ化シクロブタン C ₄ F ₈	121,600	145%	185,000	152%	228,200	123%	240,900	106%	335,200	139%
8	塩素 Cl ₂	389,300	109%	357,500	92%	324,900	91%	335,600	103%	373,000	111%
9	ゲルマン GeH ₄	240	100%	240	100%	240	100%	—	—	—	—
10	臭化水素 HBr	165,800	101%	151,200	91%	137,800	91%	174,200	126%	212,200	122%
11	アンモニア NH ₃	3,145,400	89%	2,901,200	92%	2,871,200	99%	4,402,100	153%	4,698,500	107%
12	三フッ化窒素 NF ₃	1,309,100	80%	1,665,200	127%	1,580,500	95%	1,780,500	113%	2,693,000	151%
13	一酸化二窒素 N ₂ O	1,176,200	96%	1,029,800	88%	1,042,800	101%	1,139,300	109%	1,626,000	143%
14	ホスフィン PH ₃	7,400	107%	7,500	101%	6,600	88%	6,700	102%	7,500	112%
15	モノシラン SiH ₄	305,600	97%	348,000	114%	307,900	88%	339,500	110%	278,200	82%
16	ジクロロシラン SiH ₂ Cl ₂	166,700	89%	200,200	120%	174,600	87%	174,200	100%	168,200	97%
17	四フッ化ケイ素 SiF ₄	7,000	108%	7,000	100%	7,000	100%	7,000	100%	7,000	100%
18	TEOS (C ₂ H ₅ O) ₄ Si	614,800	125%	751,800	122%	809,100	108%	925,900	114%	1,037,500	112%
19	六フッ化硫黄 SF ₆	215,000	102%	215,000	100%	217,500	101%	214,900	99%	224,600	105%
20	六フッ化タングステン WF ₆	185,000	153%	230,000	124%	213,500	93%	224,900	105%	241,700	107%
21	有機金属	2,200	105%	1,900	86%	—	—	—	—	—	—